

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態
及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

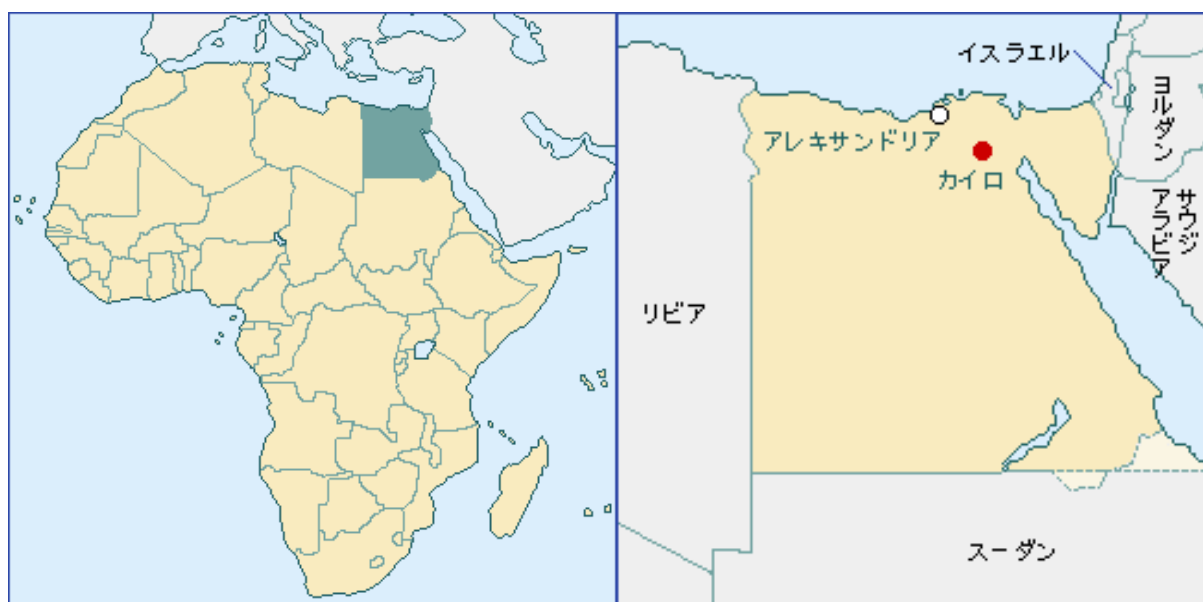
(2) エジプト・アラブ共和国 (Arab Republic of Egypt(EG)) ⁴³



人口：8415.0 万人⁴⁴

GDP：26 兆 4701 億円⁴⁵

公用語：アラビア語、都市部では英語も通用⁴⁶



知財庁 上部組織	Academy of Scientific Research and Technology (ASRT)		Ministry of Trade and Industry			
知財庁	Egyptian Patent Office		Trademarks and Industrial Designs Office			
知財庁 Web サイト	http://www.egypo.gov.eg		http://www.mfti.gov.eg			
知財庁長官	Mr. Adel El-saaed Oweida		Mr. Amr Hegazy			
知財庁 職員数 ⁴⁷ (2012 年)	職員数：265 名 (特許審査官：95 名、事務官：170 名)		職員数：155 名 (データ年不明) (意匠審査官：14 名、商標審査官：20 名、審 判官：6 名、管理者：65 名、事務官：50 名)			
知財庁予算 (2012 年)	22 億 6350 エジプトポンド (EL) (約 332 億円、1EL=14.7 円)		データなし			
現地知財庁への出 願数 ⁴⁸	年	2008	2009	2010	2011	2012
	特許(内 PCT)	2,130 (1,550)	1,942 (1,375)	2,230 (1,544)	2,209 (1,537)	2,211 (1,474)
	意匠(非居住者のみ)	2,115	2,013	データなし	2,044	2,361
	商標(非居住者のみ)	3,340	2,828	3,942	4,493	4,314

⁴³ <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/africa.html>(2014/1/10) (外務省 Web サイトより引用、地図含む)

⁴⁴ <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx> (2013/8/28)

⁴⁵ <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx> (2013/8/28)

⁴⁶ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_africa/data.html#section1(2014/1/10) (外務省 Web サイトより引用)

⁴⁷ ヒアリングによる

⁴⁸ http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/za.html(2014/1/31)

(2-1) 一般経済事情

エジプトは北アフリカ最大の人口と GDP を有する国である。世界有数のナイル川を有するため農業のポテンシャルは高く、天然ガスを中心とした資源にも恵まれている。

エジプトの主な輸出品は、天然ガス、肥料、貴金属、野菜・果実等、衣服等、石油化学製品、セメント、鉄鋼などである。中でも天然ガスを中心とした鉱物性燃料は約 30%を占めている⁴⁹。一方、エジプトの主な輸入品は、穀物（小麦、トウモロコシ等）、車や車部品、機械類、鉄鋼、電機機器等、石油化学製品、医薬品などで構成されている。

(2-2) 政府及び団体の知財についての取組み及び知財に対する姿勢

ヒアリングによると、2013年時点では政治的に混乱しているため、政府及び団体の知財についての取組み及び知財に対する姿勢に関する情報は無い。

(2-3) 知的財産権関連制度（知財庁）の運用実態上の課題・留意点・リスク等

a) エジプト特許庁 (Egyptian Patent Office)

エジプト特許庁の業務としては、特許出願及び実用新案登録出願の受理、予備的審査、実体審査、登録並びに登録後の年金の取り扱いが挙げられる。このほかにも、特許及び実用新案に関する調査の実施などがある。

エジプトでは特許の実体審査が行われている。ヒアリングによると、国際調査報告や特定の他国の審査結果を参考にしながら、独自の審査を行っているようである。エジプト特許庁は、国際調査機関 (ISA) と国際予備審査機関 (IPEA) としての能力の向上のために、ヨーロッパ特許庁 (EPO) と協議をおこなっていた⁵⁰。2013年4月1日から、国際調査機関 (ISA) と国際予備審査機関 (IPEA) としての業務を正式に開始した⁵¹。

オンライン出願を受け付けるシステムは完備されておらず、書類での出願が必要である。現在は、電子出願を可能にするように整備を進めているようである⁵²。

内部のデータベースには、特許の登録や法的な状態 (legal status) を記録できる⁵³。ヒアリングによると、審査のための内部のデータベースは、ヨーロッパ特許庁 (EPO) が提供した EPOQUE Net を使用している。外部データベースとしては、Esp@cenet、JAPIO、USPTO、WIPO などを使用している⁵⁴。また特許庁は他国の特許に関する文献を所有しており、代表的な国としてドイツ、アメリカ、フランス、イギリス、EPO などが挙げられる。簡易ながら英語でのオンラインの検索が可能である⁵⁵。データベースの問題点としては、他国のデータベースを使用しているものの、ロシア語、中国語、韓国語、日本語のデータベースが利用できないことが挙げられる。そのため日本語以外の上記言語は機械翻訳で対

⁴⁹ 世界貿易投資報告エジプト 2013 年度 (JETRO)

⁵⁰ Annual Technical Report 2008(Egypt patent office)

⁵¹ pct_newsletter_2013_03(p.4)

⁵² Annual Technical Report 2008(Egypt patent office)

⁵³ Annual Technical Report 2008(Egypt patent office)

⁵⁴ Annual Technical Report 2008(Egypt patent office)

⁵⁵ <http://www.egypo.gov.eg/Search.aspx?lang=en>

応しているようである⁵⁶。

特許・実用新案規則⁵⁷が整備されており、ヒアリングによれば、審査基準⁵⁸もある。特許の実体審査での問題点として、特定の分野における審査官の不足のため、多数の分野を特定の審査官でカバーしなければならないことが挙げられる。実体審査の技術的な問題点としては、進歩性と発明の単一性の審査が挙げられる⁵⁹。

エジプト特許庁は、EPOQUE Netの訓練や特許審査官の訓練などのため、ヨーロッパ特許庁（EPO）と協力関係にある。またヒアリングによると中国や米国とも協力関係にあるようである。エジプト・カイロで2013年に開催されたWIPOアカデミーに参加している。またエジプト特許庁は、アラブ地域の知財の訓練拠点を設けており、アラブ諸国（シリア、ヨルダン、スーダンなど）の訓練生を受け入れている⁶⁰。

b) エジプト商標・意匠庁 (Egyptian Trademarks and Industrial Designs Office)

エジプト商標・意匠庁の業務としては、商標出願及び意匠出願とそれらに関連した手続（出願受理、公報発行、登録、登録証発行、更新、記録の変更等）が挙げられる。

エジプト商標・意匠庁が、知的財産に関する事項を取り扱う際に支援を受ける機関としては、WIPOが挙げられる。WIPOは、特許、商標、意匠及び原産地名称に関する出願、管理、調査などの知的財産保護のためのグローバルサービスを提供している。

エジプト商標・意匠庁は、今のところ出願をオンラインで受け付けておらず、また、データベースのオンライン化もされていない。ただし、2011年にWIPOの協力によりITシステム化を進めるMOU⁶¹が交わされており、その後の2年間でシステムを構築する予定とされていた。また2013年から試験的に商標の公告をオンラインで開始しているようである⁶²。

(2-4) 知的財産権関連制度（特許）の運用実態上の課題・留意点・リスク等

a) 審査

(i) 実体審査

<法律・規則・制度>

エジプト特許庁の審査は、以下に規定されている。

第16条

本法第1条、第2条、第3条の規定に従い、特許庁は、発明が新規のもので進歩性を含みかつ産業上利用可能であることを確認するために、特許出願及びその付録を審査するものとする。

⁵⁶ Challenges of examination at the Egyptian

⁵⁷ <http://www.egypco.gov.eg/PDFs/english/Regs%20Law%2082.pdf> (2014/1/24)

⁵⁸ 概要として STANDARD OF THE SUBSTANTIAL EXAMINATION FOR PATENTS IN EGYPT を入手。添付資料5

⁵⁹ Challenges of examination at the Egyptian

⁶⁰ Annual Technical Report 2008(Egypt patent office)

⁶¹ http://www.wipo.int/global_ip/en/news/general/2011/news_0002.html (2014/2/4)

⁶² http://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=27 (2014/2/5)

<運用・実態>

ヒアリングによると、審査については、方式的な審査に加えて、新規性・進歩性等を判断する実体的な審査が行われている。実体審査を行って、拒絶理由があった場合は拒絶理由が通知されるが、このようなエジプト特許庁から書類はアラビア語で記載されているため、拒絶理由の内容も現地代理人の英語による報告を参照するより他になく、また、特許庁への提出書類もアラビア語で作成しなければならないため、日本語・英語・アラビア語という二重の翻訳作業が必要となる点が、出願人・代理人にとっては時間的にも費用的にも負担になると考えられる。

またヒアリングによれば、早期審査（加速審査又は優先審査）制度はない。

b) 異議・無効

(i)異議(Opposition)

<法律・規則・制度>

異議申立制度については、知的財産法第 16 条に規定されているとおりである。異議の通知は特許庁に送付され、異議申立は同第 36 条に規定されている委員会で審査される。委員会は、上訴裁判所(the court of appeal)の裁判官が委員長になり、副裁判官と 3 人の専門家で形成される⁶³。

<運用・実態>

ヒアリングによると、委員会は通常毎年形成されているが、近年の政情不安により委員会が形成されていない場合もあるようである。なお委員会の決定に対して不服のある場合は、行政裁判所(Administrative Court)に決定から 60 日以内に申し立てることができる。

(ii)無効(revocation)

<法律・規則・制度>

第 28 条に規定されているとおり、特許庁又は利害関係人は、特許の無効を行政裁判所(Administrative Court)に申立てることができる。

<運用・実態>

ヒアリングによれば、特許性については、エジプト特許庁の審査を参考にする。

(iii)強制実施権

<法律・規則・制度>

同第 28 条に、強制実施権の規定がある。

<運用・実態>

ヒアリングによると、発明の不実施に基づく強制実施権がエジプトで実際に付与された例は今のところない。

(2-4) 知的財産権関連制度（意匠）の運用実態上の課題・留意点・リスク等

a) 定義・登録要件

(i)意匠制度・分類

⁶³ Practical Guide to Intellectual property in Africa(p.147)

<法律・規則・制度>

部分意匠制度・関連意匠制度は規定されていない。分類も規定されていない。

<運用・実態>

ヒアリングによると部分意匠に似た制度はある。またロカルノ分類は採用せず、エジプト独自の分類を使用し、商標・意匠庁が分類している。

(ii)意匠の定義

<法律・規則・制度>

意匠の定義は、知的財産法第 119 条に規定されている。

<運用・実態>

ヒアリングによると、保護されうる意匠は下記のとおりである。

- ・有体物（不動産を含む）・・・保護される
- ・有体物（不動産を含まない）・・・保護される
- ・極小意匠（肉眼で視認できないもの）・・・保護されない
- ・建築物・・・保護される
- ・動的意匠・・・保護される
- ・光（花火、イルミネーション等）・・・保護される
- ・店舗等の室内ディスプレイやレイアウト・・・保護されない
- ・包装ラッピング・・・保護される
- ・画像（表示される物品を特定して）・・・保護される
- ・画像のみ（表示される物品を特定しない）・・・保護される
- ・テキスタイル（布として）・・・保護される
- ・テキスタイルのみ（物品を特定しない）・・・保護される
- ・3次元（3D）画像・・・保護される
- ・ホログラム・・・保護される
- ・グラフィックシンボル・・・保護されない
- ・アイコン・・・保護されない
- ・設計図・・・保護される

b) 審査

<法律・規則・制度>

知的財産法第 124 条及び第 125 条に、審査に相当する規定がされている。

第 124 条

次の意匠は登録してはならない。

- (1)その形が基本的に製品の技術又は機能的要件に由来する意匠
- (2)紋章、宗教上の象徴、エジプト又は他国の旗又は印章を含む場合、又はその使用が公序良俗に反する意匠
- (3)登録商標若しくは周知標章と同一、類似、又は極めて似ている意匠

登録出願が拒絶された全ての場合、標章登録局はその決定日から 30 日以内に、受領確認付書留郵便による書面によって出願人に連絡しなければならない。

第 125 条

標章登録局は出願人に、第 124 条及び規則に規定された規定を満たすために必要とされる一定の補正又は補足を施すよう求めることができる。それがないときは、出願人は出

<運用・実態>

ヒアリングによると、実体審査は行われている。ただし加速審査などの制度は採用していない。

c) その他

(i)強制実施権

<法律・規則・制度>

知的財産法第 129 条に規定されている。

<運用・実態>

ヒアリングによれば、意匠の不実施に基づく強制実施権がエジプトで実際に付与された例は今のところない。

(2-6) 知的財産権関連制度（商標）の運用実態上の課題・留意点・リスク等

a)定義・登録要件

(i)周知・著名商標

<法律・規則・制度>

知的財産法第 68 条には周知・著名商標と同一又は類似の商標の登録は許されない旨が規定されている

<運用・実態>

ただし、周知・著名商標と同一又は類似の商標の登録は許されないためには、以下の三つの条件を満たす必要がある⁶⁴。

1. 周知・著名商標が、WTO 加盟国の少なくとも 1 か国に登録されている。
2. 周知・著名商標と同一又は類似の商標の使用により、周知・著名商標の所有者と周知・著名商標と同一又は類似の商標の使用者と関係があると、消費者に思われる恐れがある。
3. 周知・著名商標と同一又は類似の商標の使用により、周知・著名商標の所有者に損害を与える要因となる恐れがある。

(ii)新しい商標

<法律・規則・制度>

登録要件として、知的財産法第 63 条には、すべての場合において商標は視覚によって認識できる標識でなければならないことが規定されている。

<運用・実態>

ヒアリングによると、新しい商標（音、におい等）は登録できない。

(iii)分類

⁶⁴ http://www.abdelhadi-ip.com/show_pdf.html?a=FAQ-Egypt (2014/2/10)

<法律・規則・制度>

ニース協定には加盟している。

<運用・実態>

分類はニース分類第 10 版を採用している⁶⁵。

(iv)使用主義・登録主義

<法律・規則・制度>

登録要件に、商標の使用は規定されていない。

<運用・実態>

登録主義を採用している。ただしコモンロー上の権利(知的財産法第 65 条下線部参照)も考慮されている。

第 65 条

商標が登録されその登録日から 5 年以内にこれを使用した者は、当該商標の所有者とみなされるものとする。ただし、第三者による使用の優先が証明される場合を除く。
 標章の先行使用者は、当該 5 年の期間内に、その登録の有効性に異議申立てできる。
 ただし、標章の登録は登録が悪意で成された場合にはいつでも異議申立てできる。

(v) 多区分出願制度

<法律・規則・制度>

知的財産法 74 条に基づき、多区分出願制度を採用している。

<運用・実態>

2011 年 4 月時点では行政上の理由で複数の区分を持つ商標の出願を受理していない⁶⁶。

b) 公開・公告

<法律・規則・制度>

知的財産法第 83 条に規定されている。

第 83 条

標章の登録は標章登録局の決定によって承認され、規則に規定された方式により、商標及び意匠官報で公告されなければならない。登録は出願提出日から有効となる。

<運用・実態>

オンラインで公告されているようであるが、確認できなかった⁶⁷。

c) 審査

(i)実体審査

<法律・規則・制度>

知的財産法第 77 条に、実体審査に相当する規定がある。実体審査の審査基準はあるが、公開はされていない。

⁶⁵ [http://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=27\(2014/2/5\)](http://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=27(2014/2/5))

⁶⁶ http://www.abdelhadi-ip.com/show_pdf.html?a=FAQ-Egypt (2014/2/10)

⁶⁷ http://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=27 (2014/2/5)

第77条

標章登録局は、決定の理由を述べた上で、すでに登録されている標章又はすでに登録出願が提出されている標章との混乱を避けるべく標章を定義し明確にするために、出願人に対して主題とする標章に必要な修正をするよう要求することができる。

<運用・実態>

出願された標章は、標章登録局による方式審査終了後、先行商標の権利との関係や、出願された標章の登録性について、実体審査を行う⁶⁸。

d) 異議・無効・取消

(i) 異議(opposition)

<法律・規則・制度>

知的財産法第 80 条に異議申立制度(opposition)が規定されている。

<運用・実態>

知的財産法第 80 条に基づいて、手続きが行われる。出願人又は異議申立人の要請によってヒアリングが行われる。決定後、双方に 10 日以内に行われる。異議申立が成功しなかった場合は、出願人は 90 日以内に登録手続きを行う必要がある。また異議申立人は、決定の不服を行政裁判所に訴えることができる⁶⁹。

(ii) 無効・取消(removal・cancellation)

<法律・規則・制度>

無効(removal)については、知的財産法第 94 条に規定の通りである。また取消(cancellation)については、知的財産法第 91 条に規定の通りである。

第 91 条

連続した 5 年間において標章が真剣に使われていないと認められる場合、管轄裁判所は利害関係人の請求により、登録取消の、法的強制力のある判決を下すことができる

<運用・実態>

上記下線部の「真剣な使用」の定義はない⁷⁰。

(iii) 第三者による悪意の商標出願

第三者による悪意の商標出願の対応について、以下の二つのケースを想定して、事務所にヒアリングを行った結果を記載する。

<ケース 1>

A 社の周知・著名商標がエジプトで商標登録されておらず、かつ A 社がエジプトで事業も行っていない場合に、第三者が悪意をもってエジプトで同一・類似の商標登録した場合

⁶⁸ http://www.abdelhadi-ip.com/show_pdf.html?a=FAQ-Egypt (2014/2/10)

⁶⁹ Practical guide to intellectual property in Africa (2014/2/11) p.140

⁷⁰ Practical guide to intellectual property in Africa (2014/2/11) p.142

(回答) ヒアリングによると、第三者の商標登録を取り消すには、A 社がエジプトをカバーするその商標の国内登録又は/及び国際登録を有している必要があり、有していない場合は難しい。A 社のその商標はエジプトで周知である必要があり、貴社はその証拠を持っている必要がある。

<ケース 2>

A 社の周知・著名商標がエジプトで商標登録されておらず、日本では商標登録されていて、かつ A 社がエジプトで事業も行っている場合に、第三者が悪意をもってエジプトで同一・類似の商標登録した場合

(回答) ヒアリングによると、A 社のエジプトでの強力な先使用を証明し、証拠を提出することによって、A 社は、エジプトで未登録のその商標についての権利（先使用权）を有することになり、第三者に対して、取消訴訟を提起することができる。

(2-7) 知的財産権関連制度（著作権）の運用実態上の課題・留意点・リスク等 <法律・規則・制度>

ヒアリングによると、応用美術は保護される

<運用・実態>

ヒアリングによると、自動車部品などの工業デザインは、著作権では保護されない。

(2-8) 裁判所・税関・警察等の体制及びエンフォースメント環境

a) 裁判所

エジプトは、フランス法の影響を強く受けている。エジプト⁷¹は、行政事件を管轄する行政裁判所と刑事・民事事件を管轄する司法裁判所がある。ヒアリングによると、エジプト特許庁・エジプト商標・意匠庁の決定（異議・無効・取消など）については行政裁判所が取扱い、知的財産権に関する侵害や係争などは、司法裁判所が取り扱う。

2008 年に経済関係の裁判を迅速に処理するために、司法裁判所の一種である経済裁判所 (economic court) が設立され、独占的に知的財産権法に関する紛争を処理する役割がある。ヒアリングによれば、経済裁判所は、内部で Courts of First Instance ("CFI") と Appellate Courts ("AC") とに分かれている。500 万エジプトポンド以下の事件の裁判は、CFI での（日本での）第一審扱いとなり、500 万エジプトポンド以上の事件の裁判は AC での（日本での）第一審の扱いになる。500 万エジプトポンド以下の事件の裁判の二審は AC となる。500 万エジプトポンド以上の事件の裁判での二審は破毀院 (the Court of Cassation) となる。またエジプトには、裁判所において、模倣品を取り締まるための部署がある。

b) 税関

ヒアリングによると、エジプトには、税関において、模倣品を取り締まるための部署がある。エジプトの税関で、取締の根拠となる知的財産権の例としては、特許権、商標権、

⁷¹ [http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Egypt\(2014/2/14\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Egypt(2014/2/14))

意匠権、実用新案権、著作権、その他著作隣接権、半導体回路の回路配置、及び地理的表示が挙げられる。中でも、模倣品の取締りではしばしば用いられるのは商標に関する規定である。

ただし、ヒアリングによれば、税関で模倣品を差し止めるために、担保金の支払い、模倣品の自助努力による発見、税関職員の質があまり高くない、税関で知財権による差し止め権限がないため、裁判所から差し止め命令が必要などの理由で、エンフォースメントを行うのは、多くの手間と時間、費用がかかるとの意見が聞かれた。

c) 警察

ヒアリングによると、エジプトには、警察において、模倣品を取り締まるための部署がある。模倣品対策として行われている新しい措置としては、供給捜査隊(supply investigation unit)への苦情の申立て (filing a complaint) が挙げられる。この供給捜査隊は、特別に組織された警察部隊 (specialized Police Department) であって、エジプトにおける知的財産のエンフォースメントの責任を負っている。

d) エンフォースメント環境

ヒアリングによると、税関、警察は一応機能しており、商標については模倣品の取締を行える環境にある。そのため行政・司法手続きをすればエンフォースメントは可能であるが、時間がとても掛かるのが問題であるという意見が聞かれた。

(2-9) 模倣品の状況、侵害品摘発実績

ドバイからの、膨大な模倣品がエジプトに流入しており、エジプトの消費者は、模倣品と知りながら (あるいは知らずに)、それらを非常に容易く購入している現状がある⁷²。

ヒアリングによると、税関で模倣品の差し止め処置を行った経験があるが、理由もなくリリースされた例が聞かれた。

(2-10) 権利取得手続及び訴訟手続等に要する時間的・金銭的成本

a) 権利取得手続及び訴訟手続等に要する時間的・金銭的成本 (特許)

(i) 権利取得手続

・金銭的成本 (出典: Adams&Adams)

手続き名称	手続き詳細	知財庁へ支払う費用	事務所へ支払う手数料
出願 (注1)	Application	USD64.40	USD2,300~2,500
審査	Examination	USD1,380 ⁷³	USD290

⁷² 中東・アフリカニューズレター vol. 6 世界に広がる模倣品の問題 — エジプトにおける現状と展望

⁷³ エジプト特許庁 Web サイトでは LE2,000(USD280)となっているが、WIPO 資料によると PCT による国内移行の審査費用は LE7,000 (USD980) となっている

(<http://www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol2/annexes/eg.pdf> (2014/1/28))

応答	Responding to official actions and filing amendments	USD55	Time based
	Grant (including receiving, checking and forwarding the LP)	データなし	USD510
登録	Issuance of the Letters Patent	USD23	なし
特許維持年金 (注2)	Annual fees	別表 1,2 記載	USD212/年
年金遅延金	Extension Cost	別表 1,2 記載	USD100/年
異議	Opposition	USD83	USD320

(注1) 請求項の数に応じた加算は見当たらなかった。

(注2) 個人・中小企業及び学生の出願に対して割引制度がある。

なお一般的に、アフリカ諸国の知財庁に支払う特許維持年金額は、知財庁の Web サイトに掲載されている情報が古い場合があるため、参考として法律事務所からヒアリングで得た情報も併記した。

別表1：特許維持年金（出典：エジプト特許庁）（LE エジプトポンド/USD0.1474）

年度	年金	遅延金	年度	年金	遅延金
1	-	-	11	400	28
2	20	1.4	12	500	35
3	40	2.8	13	600	42
4	80	5.6	14	700	49
5	100	7	15	800	56
6	150	10.5	16	900	63
7	200	14	17	1000	70
8	250	17.5	18	1000	70
9	300	21	19	1000	70
10	350	24.5	20	1000	70

別表2：特許維持年金（出典：Adams&Adams）

年度	年金	遅延金	年度	年金	遅延金
1	-	-	11	USD270.25	USD18.92
2	USD80.50	USD4.43	12	USD310.50	USD21.73
3	USD92.00	USD5.23	13	USD345.00	USD24.15
4	USD103.50	USD6.04	14	USD368.00	USD25.76

⁷⁴ 交換レートは最新のものを提示したが、最近の政情からドル換算値は再確認が必要

5	USD115.00	USD6.84	15	USD402.50	USD28.17
6	USD126.50	USD8.85	16	USD425.50	USD29.78
7	USD155.25	USD10.87	17	USD460.00	USD32.20
8	USD184.00	USD12.88	18	USD460.00	USD32.20
9	USD212.75	USD14.89	19	USD460.00	USD32.20
10	USD241.50	USD16.90	20	USD460.00	USD32.20

- ・ 時間的コスト

出願から審査までに要する期間は通常12～18か月、出願から登録までにかかる期間は、通常24～36か月である。登録から登録通知までは6ヶ月程度かかる。審査請求制度がないため、審査時間は不明である。

(ii) 訴訟手続

- ・ 金銭的コスト

ヒアリングによると、裁判までの事務所依頼費用は、約USD3,500～4,000かかる。

- ・ 時間的コスト

ヒアリングによると、裁判には、通常約2～3年かかる。

b) 権利取得手続及び訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト（意匠）

情報は得られなかった。

c) 権利取得手続及び訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト（商標）

(i) 権利取得手続

- ・ 金銭的コスト

手続名称	手続詳細	知財庁への支払い 費用	事務所へ支払う 手数料
出願（1区分）	Application	USD550	USD444
	Priority Claim, per application	USD46	USD49
	Publication charges	USD138	USD100
登録	Registration attendances	USD136	USD120
Assignment	1st application/registration	USD300	USD285
	2nd application/registration	USD300	USD119
Renewal	1st registration registration	USD255	USD268
	2nd registration	USD255	USD201
名義変更	Change of Name	USD145	USD124
住所変更	Change of Address	USD145	USD54
検索	Search 1trademark per class	USD220	USD247
異議	Opposition	USD50	USD260 (*)

- ・ 時間的コスト

ヒアリングによると、出願から審査までは、6～10 か月程度かかり、出願から登録まで18 か月かかる。

(ii) 訴訟手続

- ・ 金銭的コスト

ヒアリングによると、裁判（侵害訴訟）までの事務所依頼費用は、約 USD5,000 かかる。

- ・ 時間的コスト

ヒアリングによると、裁判（侵害訴訟）まで12～18 か月かかり、最終判決までは、通常約2～3年かかる。

(2-1 1) ライセンス契約／海外送金等における規制

外国の生産者又は供給者は、技術移転契約又はライセンス契約をエジプト企業との間で締結することができる⁷⁵。この場合、エジプト国内での外国製品のマーケティングは行われないため、代理店を選任する必要はない。正確には、外国企業からライセンスを受けて生産するエジプトの企業が、自己の製品についてマーケティングを行うことになる。外国企業に支払われるロイヤルティに対しては20%の税金が課され、ロイヤルティの支払時に源泉徴収される。但し、エジプトが当事者となるいくつかの二重課税条約（例えば対アメリカ間）では、税率は15%までに引き下げられている。

また日本からのライセンス契約に関しては、経済産業大臣の許可が必要になる場合がある⁷⁶。

銀行およびエジプト中央銀行から発行された許可証により許可を受けた送金サービス会社のみが、エジプトから外国に金銭を送金することができる⁷⁷。送金サービス会社は、エジプトの株式会社の形態を取らなければならない、かかる業務を唯一の事業目的として設立されなければならない。また、払込済資本金は500万LE以上でなければならない。

また日本からの送金については、日本の外為法の規制に抵触しない限り送金は可能である⁷⁸。

⁷⁵ https://www.jurists.co.jp/ja/publication/tractate/docs/egypt_J.pdf p.11(2014/2/15)

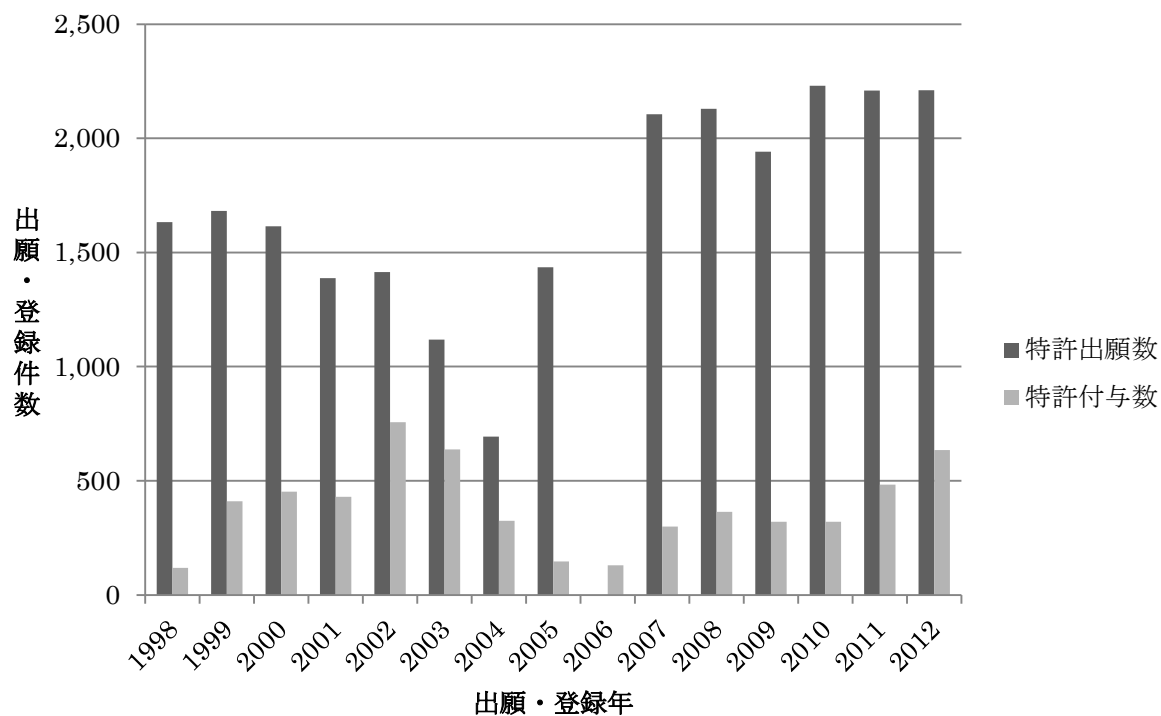
⁷⁶ <http://www.meti.go.jp/policy/ampo/ampo03.html> (2014/2/15)

⁷⁷ <https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000696/report.pdf>(2014/2/16)

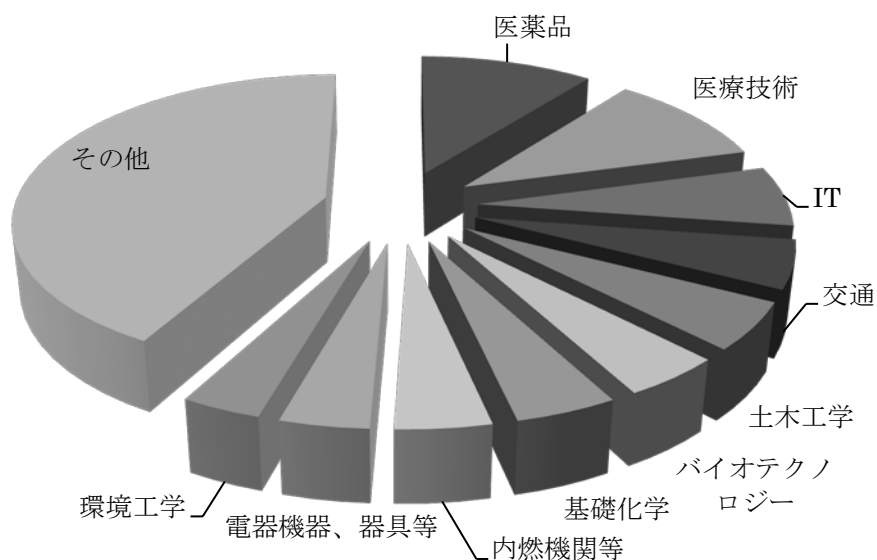
⁷⁸ [https://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-011104\(2014/2/15\)](https://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-011104(2014/2/15))

(2-1 2) 出願件数推移 (エジプト)

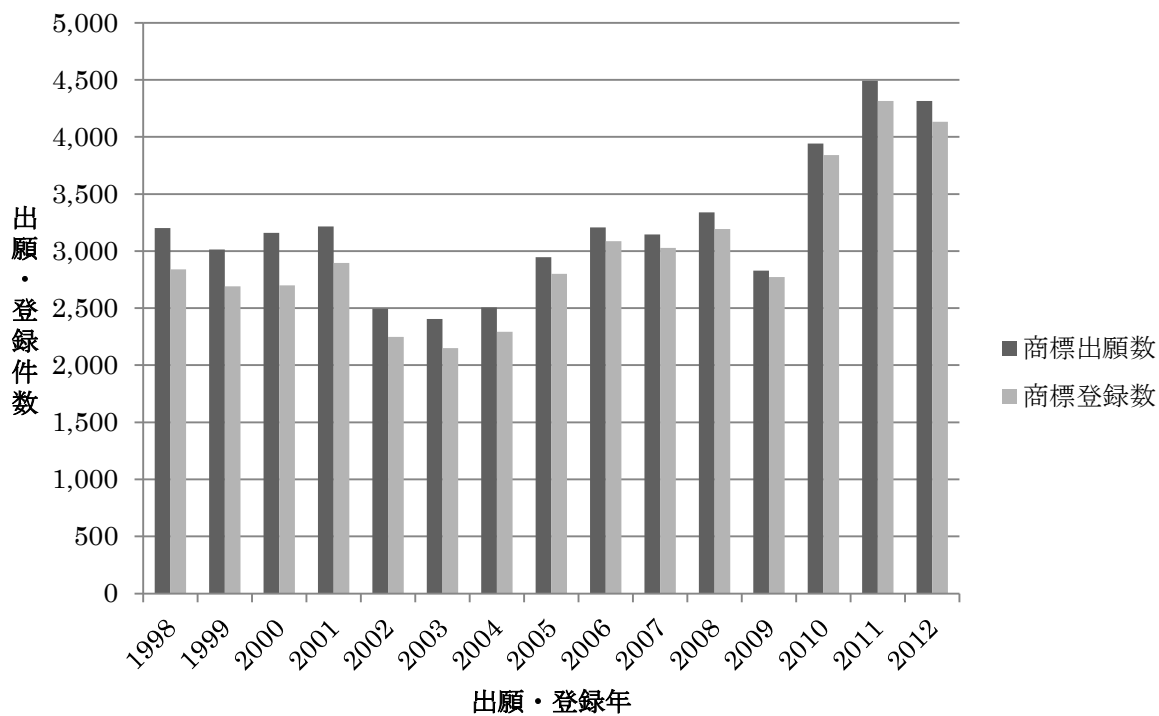
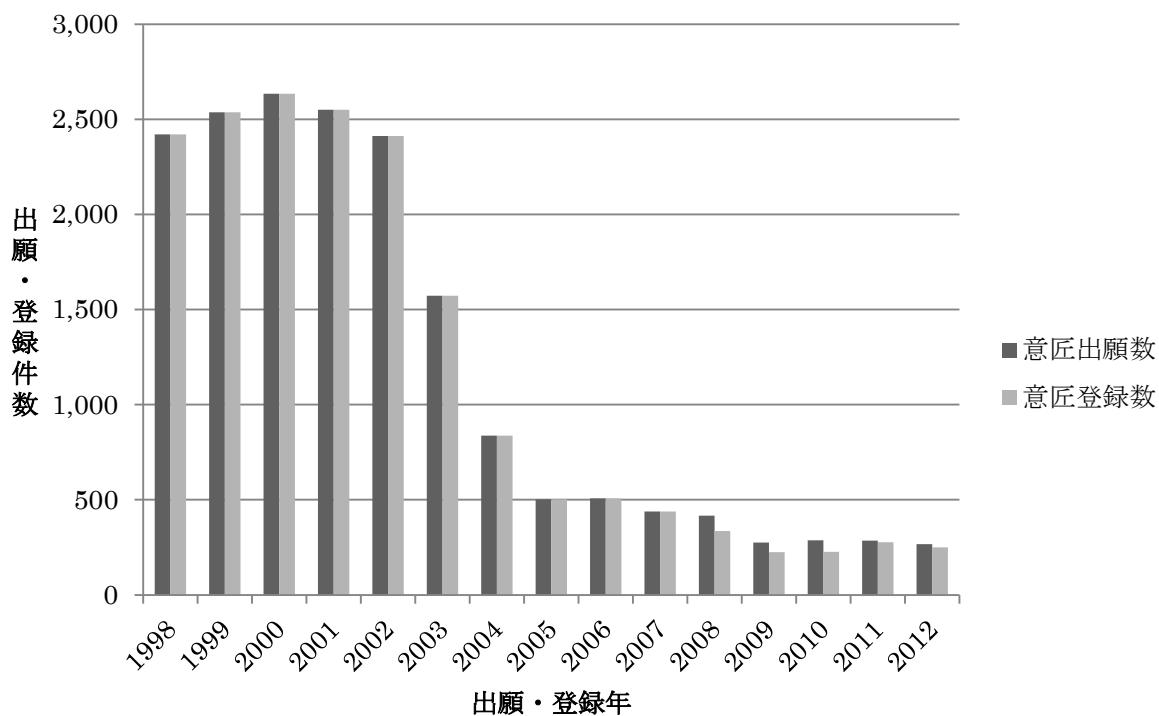
a) 特許統計 (エジプト)



特許出願分野内訳(1998-2012)



b) 意匠・商標統計 (エジプト)



(2-13) 企業による調査対象国における知財活動 (エジプト) 79

＜出願人別特許出願数＞

出願人	名称	業種	国	出願件数
NOVARTIS AG	ノバルティス	製薬	スイス	148
ASTRAZENECA AB	アストラゼネカ	製薬	英国	131
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	バイエル製薬	製薬	ドイツ	67
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	ボーリンガーインゲルハイム	製薬	ドイツ	62
SANOFI-AVENTIS	サノフィ・アベンシス	製薬	フランス	61
JANSSEN PHARMACEUTICA	ヤンセンファーマ (注: ジョンソン&ジョンソン (米) の子会社)	製薬	日本	60
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	プロクター&ギャンブル	ヘルスケア	米国	59
GLAXO GROUP LIMITED	グラクソグループ (注: 合併してグラクソ・スミスクライン (英))	製薬	英国	43
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	大塚製薬	製薬	日本	40
المركز القومي للبحوث	ナショナルリサーチセンター	製薬・化学	エジプト	39
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY	武田薬品	製薬	日本	37
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	ロシュ	製薬	スイス	34
MICROSOFT CORPORATION	マイクロソフト	ソフトウェア	米国	32
BAKER HUGHES INCORPORATED	ベーカー・ヒューズ	石油	米国	31
GENENTECH, INC.	ジェネンテック (注: ロシュの子会社)	バイオ	米国	27
PFIZER PRODUCTS INC.	ファイザー	製薬	米国	27
UNI-CHARM CORPORATION	ユニチャーム	ヘルスケア	日本	27
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	シンジェッタ	バイオ・農薬	スイス	26
BASF SE	BASF	化学	ドイツ	25
ELI LILLY AND COMPANY	イーライリリー	製薬	米国	23
H. LUNDBECK A/S	ルンドベック	製薬	デンマーク	22
BAYER HEALTHCARE AG	バイエル・ヘルスケア	ヘルスケア	ドイツ	21
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	シーメンス	電機	ドイツ	21
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	スミスクライン・ビーチャム (合併してグラクソ・ スミスクライン (英))	製薬	英国	21

⁷⁹[http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf\(2013/10/10\)](http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf(2013/10/10)) (エジプトのデータの掲載範囲は2008/01-2011/02)

STANDARDS OF THE SUBSTANTIVE EXAMINATION FOR PATENTS IN EGYPT

- According to the Egyptian IP Law, a patent shall be granted to any industrially applicable invention, which is new, involves an inventive step, whether connected with new industrial products, new industrial processes, or a new application of known industrial processes.
- The patent is also granted, independently, for any modification, improvement or addition to a previously patented invention, which meets the criteria of being new, inventive and industrially applicable, as stated in the preceding paragraph; in which case the patent shall be granted to the owner of the modification, improvement or addition.
- In addition, according to the Egyptian IP Law, patents shall not be granted for:
 - (1) Inventions whose exploitation is likely to be contrary to public order or morality, or prejudicial to the environment, human, animal or plant life and health.
 - (2) Discoveries, scientific theories, mathematical methods, programs and schemes.
 - (3) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for humans and animals.
 - (4) Plants and animals, regardless of their rarity or peculiarity, and essentially biological processes for the production of plants or animals, other than microorganisms, biological and microbiological processes for the production of plants or animals.
 - (5) Organs, tissues, live cells, natural biological substances, nuclear acid and genome.
- Moreover, an invention shall not be considered wholly or partly new:
 - (i) if, before the filing date of the patent application, a patent application has been filed for the same invention or a patent was already issued in or outside Egypt for the invention or thereof;
 - (ii) if, before the filing date of the patent application, the invention was used publicly in or outside Egypt, or the description of which was disclosed in a manner so as a person having expertise in the art is able to exploit it.
- Disclosure shall not include displaying the invention in national or international exhibitions within the six months before the date on which the application was filed.